

特殊半導体ガス分析装置

ケン商品開発株式会社

はじめに

半導体製造に使用される特殊ガスは増々高純度が求められ、HF中の金属元素含有濃度は、サブpptレベルに達している。一方で含有する無機ガス分析については、ガスクロマトグラフでの測定が一般的だが、HFガスの特性から未開発だった。今回、弊社とWasson-ECE共同で半導体特殊ガス中の無機ガス成分をガスクロマトグラフで測定する方法を開発した。

構成:

GC-PDHIDマルチバルブシステム

適用サンプルタイプ:

高純度フッ化水素 (HF)
高純度臭化水素 (HBr)
高純度塩素 (Cl₂)

測定対象と検出下限:

測定成分	検出下限 [ppm]
H ₂	0.5
N ₂	0.5
O ₂	1.0
Ar	0.5
CH ₄	0.5
CO ₂	0.5
CO	0.5

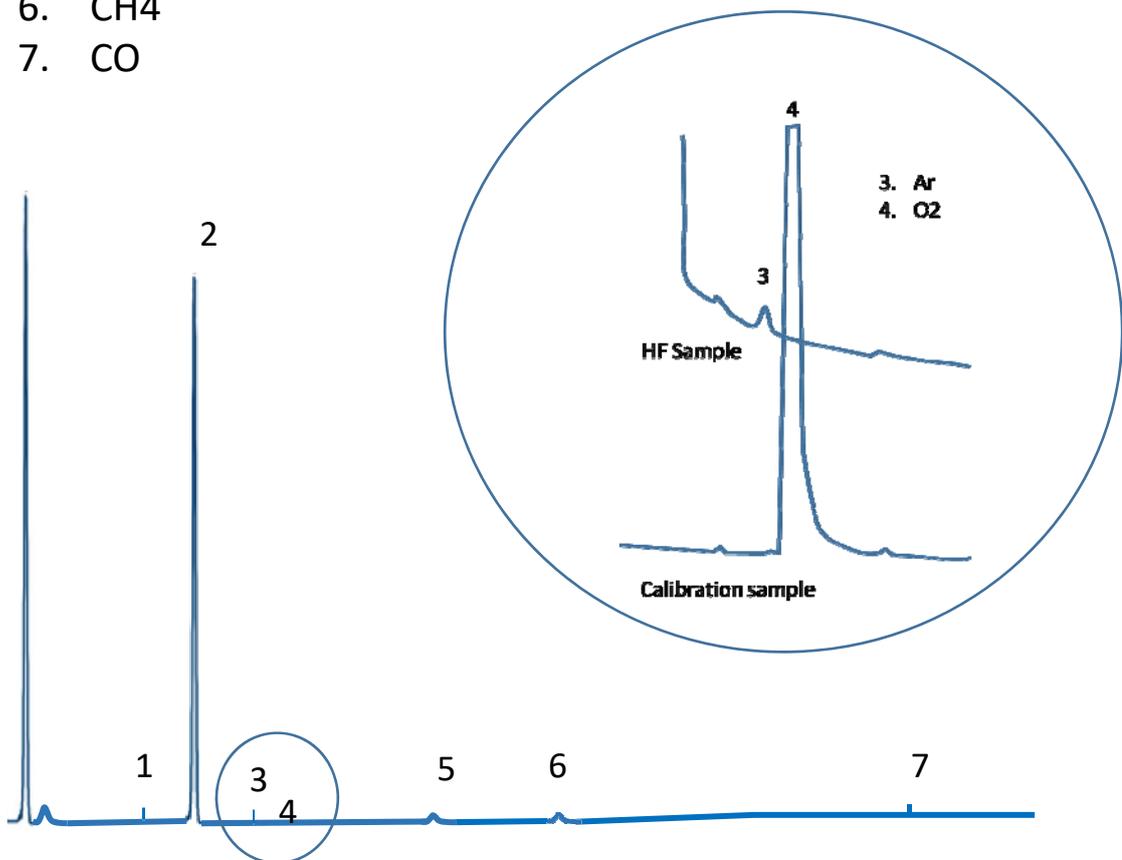


特徴

- 接液部に耐フッ酸材料を使用
- その他系内の不活性化材料の使用
- 分析時間：25分
- O₂/Ar分離：オープン初期温度30℃（液体N₂不要）
- 安定したサンプル供給と排気のためのサンプルシステムの製作

Matrix: Hydrogen fluoride

1. CO₂
2. H₂
3. Ar
4. O₂(no detection)
5. N₂
6. CH₄
7. CO



Ken 〒183-0005 東京都府中市若松町1-7-15 サンピア102
TEL: 042-306-6040
FAX: 042-306-6041
E-mail: info@ken-pd.com
URL: <https://www.ken-pd.com/profile/>